

# Осаждение нитрида кремния

**Si** подложка

или пробел для

продолжения

Все слайды

# Добавление слоя поликремния (Поли0)



Si подложка

или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Нанесение изображения через 1-ый уровень маски (Поли0), используя литографию

Структурированный фоторезист

**Si** подложка

или пробел для  
продолжения

Все слайды

# Удаление ненужного Поли0, используя реактивное ионное травление

**Si** подложка

или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Осаждение 1-ого слоя оксида,  
используя LPCVD  
(химическое осаждение из газовой  
фазы при пониженном давлении)



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения  
через маску 2-го уровня  
(углубление)  
используя фотолитографию...  
и глубинное реактивное  
ионное травление



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения  
через маску 2-го уровня  
(углубление)  
используя фотолитографию...  
и глубинное реактивное  
ионное травление



МЫШКИ  
или пробел для  
продолжения  
Все слайды

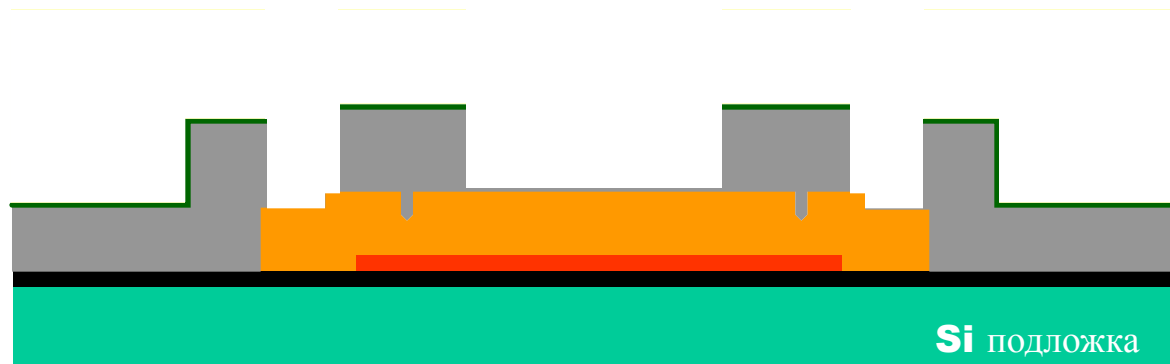
Нанесение безпримесного  
осаждённого слоя поликремния (Поли1)  
используя LPCVD...  
Затем осаждение PSG  
(фосфосиликатного стекла)  
и ОТЖИГ



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

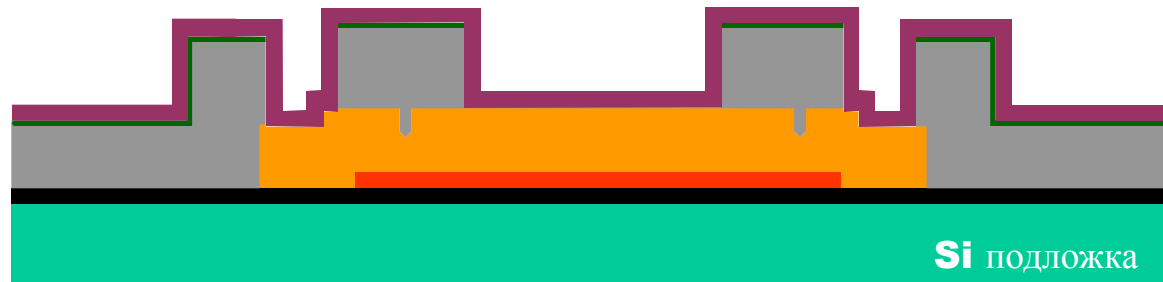


Нанесение изображения через  
4-й уровень маски (Поли1),  
используя фотолитографию...  
и глубинное реактивное  
ионное травление



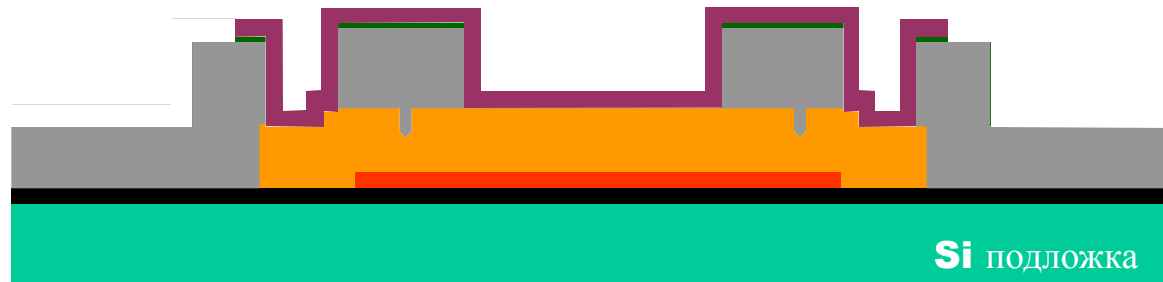
или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Осаждение 2-го слоя оксида



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

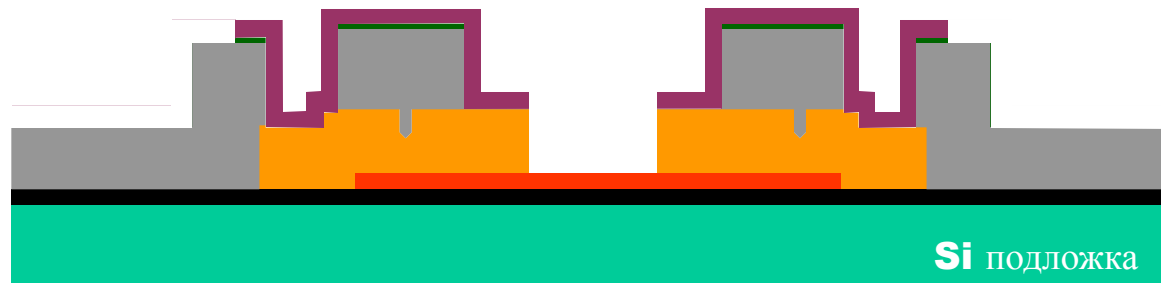
Нанесение изображения через  
маску 5-го уровня, используя  
фотолитографию и  
глубинное реактивное  
ионное травление



или пробел для  
продолжения

Все слайды

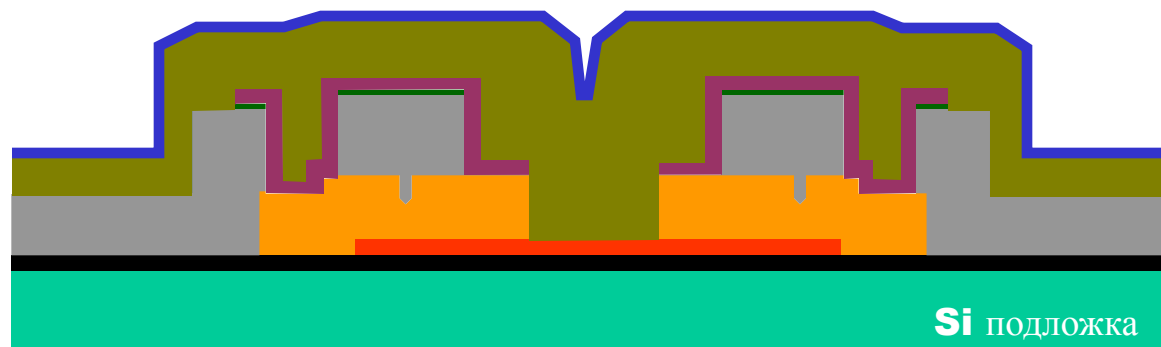
# Нанесение изображения через маску 6-го уровня, используя фотолитографию и глубинное реактивное ионное травление



или пробел для  
продолжения

Все слайды

Осаждение безпримесного поликремния,  
затем нанесение PSG  
(фосфосиликатное стекло)  
слоя жёсткой маски,  
затем ОТЖИГ



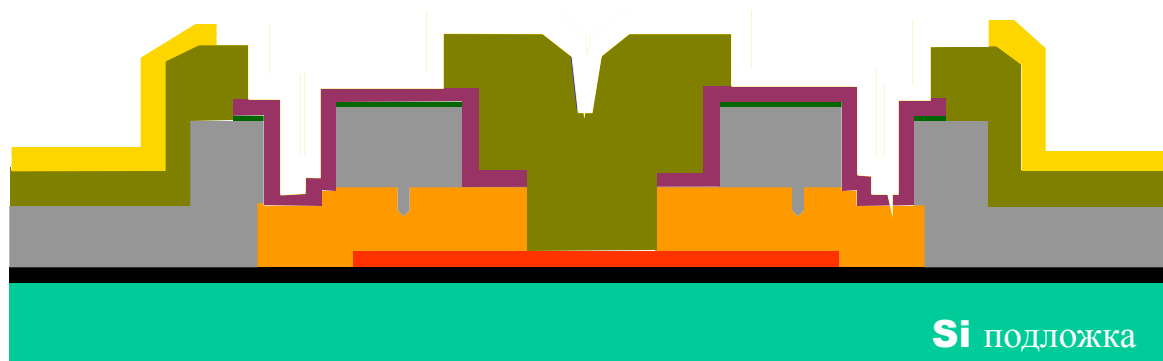
или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Нанесение изображения через маску 7-го уровня, используя фотолитографию и глубинное реактивное ионное травление



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

Нанесение изображения через маску 8-го уровня, используя фотолитографию и отрыв, затем удаление ненужного фоторезиста и металла в ванне растворителя



или пробел для  
продолжения  
Все слайды

# Реализация структуры, используя HF



или пробел для  
продолжения  
Все слайды